



Respuesta óptica de sistema: Grafeno/SiO₂/Si mediante Elipsometría

Gabriela Flores Rangel¹, Luis Felipe Lastras Martínez¹, Ricardo Castro García¹, Oscar Ruiz Cigarrillo¹, Daniel Medina Escobedo¹, Jorge Ortega Gallegos¹, Raul Eduardo Balderas Navarro¹, Maria Losurdo² y María del Pilar Morales Morelos¹

1 Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, Universidad Autónoma de SLP, 2 0.
gflores@cactus.iico.uaslp.mx

El interés en las propiedades físicas que presenta el grafeno debido a las prometedoras aplicaciones tanto tecnológicas como científicas, hace que este material sea estudiado bajo diversas técnicas que nos proporcionen información fundamental. Trabajos realizados demuestran que la visibilidad del grafeno se puede mejorar al ser exfoliado en sustratos de SiO₂/Si, y que depende del espesor de la capa de SiO₂.

En este trabajo se estudia el sistema Grafeno/SiO₂/Si mediante elipsometría espectroscópica (SE, por sus siglas en inglés) en el rango de 250nm a 650nm, con un tamaño de spot de 1mm², para su respectivo análisis se implementó el método de matrices de transferencia lo cual nos permitió conocer los espesores medios del grafeno y de las capas de SiO₂ (305nm).